⑲ 日本 国特 許 庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

平1-245868

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月2日

B 03 C C 02 F

A-8616-4D E-8014-4D B-6816-4D審査請求 未請求 請求項の数 1 (全<sup>3</sup>頁)

図発明の名称

排液処理方法

昭63-77400 ②特 M

昭63(1988) 3月29日 @出

@発

滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社

内

関西日本電気株式会社 M 勿出

滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号

発明の名称

排液処理方法

#### 持許請求の範囲

帯電した微粒子を含む魔液の排出用配管の中途 に分岐管を設け、この分岐管またはその手前に強 粒子の付勢手段を配設して、微粒子を多鼠含む排 液と微粒子を少量含む排液とに分離することを特 徴とする排放処理方法。

#### 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

この発明は排液処理方法に関し、特に例えばシ リコンウェーハの裏面研削に用いた排液の処理に 好遊するものである。

#### 従来の技術

半導体装置を製造する場合、一般にシリコンク ェーハの一主面側から不純物拡散等を行って粜子 を形成後、他主面側を研削して薄型化し、しかる のちにこの他主面側に電極を形成している。前記 他主面の研削時には、研削刃の加熱防止および研 削の結果生じるシリコンダストの洗い流しのため に水が用いられており、その排液はシリコンダス トを含んでいる。このため、この排液をそのまま 河川に放流することはできず、第2図に示すよう に、研削装置1の排液2はいったん配置3により 沈殿植 4 に入れられ、上澄排液 2 a を配管 5 。ポ ンプ6を通してUFフィルタ7で趨迫したのち廃 憂している。

## 発明が解決しようとする課題

ところで、研削装置1の排液2に含まれるシリ .コンダスト8はマイナスに帯電しているため、沈 殿槽4内でシリコンダスト8同士が反発し合って なかなか沈殿せず、UFフィルタ7が短期間で目 詰まりを起こしてしまうという問題点があった。

## 課題を解決するための手段。

そこで、この発明は帯電した微粒子を含む腓液 の排出用配管の中途に分岐智を設け、この分岐管

#### - 特別平1-245868(2)

またはその手前に微粒子の付勢手段を配設して、 微粒子を多量含む排液微粒子に少量含む排液とに 分難することを特徴とする。

#### 作用

微粒子の付勢手段は、帯電した微粒子を電磁気的に付勢し、一方の側に吸引または反発により押しやり、分岐管で微粒子を多盤含む排液と微粒子を少量含む排液とに分離する。

#### 実施例

この発明の一実施例を第1図を参照して説明する。図において、11はシリコンウェーハの研制 装置で、その排液12は配管13を通って沈殿槽 14に入れられる。この沈殿槽14内ではマイナスに帯電したシリコンダスト15同士が反発したとおりで ってなかなか沈降しないことは前述したとおりで ある。そして、この沈殿槽14の上澄排液12a が配管16、ポンプ17を通って分岐管18に帯 かれる。分岐管18の周囲にはマイナスに帯電し たシリコンダスト15の付勢手段19の一例であ る直流電源20と陽優21と陰極22とが配設さ れている。分岐管18の一方の配管18aにはUFフィルタ23が接続されるとともに、他方の配管18bにはシリコンダスト除去フィルタ24が接続されている。

上記の構成において、ポンプ17により配管1 6を通ってきた排液12aは、分岐管18に達す ると付勢手段19により、マイナスに帯電した数 粒子は陽極21に吸引されるとともに陰極22で 反発される。この結果、陰極22が配設されてい る配管18aには、シリコンダストが少量含まれ た排被12bが流れて、UFフィルタ23により 排液 1 2 b 中のシリコンダストが除去されるとと もに、関極21が配設されている配管18bには、 シリコンダストが多量含まれた排液 12 c が流れ て、フィルタ24により排液12c中のシリコン ダストが除去される。このようにして、UFフィ ルタ23は長時間にわたって目詰まりを起こすこ とがなく寿命が延びる。また、フィルタ24もシ リコンダストの除去に適する相さのものを使用で きるので短寿命になることはない。

なお、上記実施例はシリコンダストの付勢手段 19として、直流電源20と陽極21と陰極22 とを用いる場合について説明したが、直流磁界を 用いてもよい。この場合は、マイナスに帯電した シリコンダストが配管16内を流れることによっ て、恰も逆方向に電流が流れたと同様になり、磁 界によりシリコンダストが一定方向への力を受け て、分岐管18で前記同様にシリコンダストを 盈含む排液と少量含む排液とに分離される。

また、上記実施例はシリコンウェーハの研削装置の排液の場合について説明したが、帯電した後粒子を含む排液であれば同様に適用できる。

## 発明の効果

以上のように、この発明によれば、帯電した微粒子含む排液を、微粒子を多量含む排液と、微粒子の混合む排液とに分離できるから、UFフィルタを長時間にわたって使用できる。

### 図面の簡単な説明

第1図はこの発明による排液処理方法を実施す

る排液処理装置の概略構成図である。

第2図は従来の排液処理装置の機略構成図である。

16…配管、

18…分岐管、

19…微粒子の付勢手段、

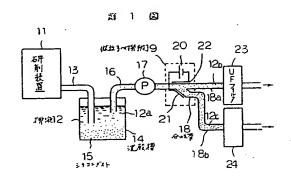
23…フィルタ、

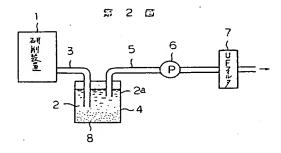
24… 微粒子除去フィルタ。

特許出願人 関西日本電気株式会社 (電)



# 特開平1-245868(3)





THIS PAGE BLANK (USPTO)